

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ISSN 2222 - 4386

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ
НАПІВПРОВОДНИКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ
СИСТЕМ
НАУКОВА РАДА НАН УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМ ФІЗИКИ
НАПІВПРОВОДНИКІВ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВОДНИКІВ
ІМ. В.С.ЛАШКАРЬОВА
ЦЗІЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА)



НМІТФ-2016

Кременчук, 26-28 травня 2016 р.

**IV МІЖДУНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ**

**НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ,
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ФОТОВОЛЬТАЇКА
(НМІТФ-2016)**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Кременчук - 2016

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО**

IV Міжнародна науково-практична конференція

**Напівпровідникові матеріали,
інформаційні технології
та фотовольтаїка**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

26–28 травня 2016 р.

Кременчук

УВЕЛИЧЕННЯ КОЕФФІЦІЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВІЯ ФОТО-ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ Cu(In,Ga)Se ₂ С КВАНТО- ВЫМИ ТОЧКАМИ InAs	63
Вельченко А.А., Мирончук В.И., Пелецак Р.М.	
ВПЛИВ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ НА РАДІАЦІЙНУ СТИЙКОСТЬ КРЕМНІЄВОГО ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА КОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	65
Гетьман А.В., Душейко М.Г., Іващук А.В.	
СЕНСОРИ КУТОВИХ КООРДИНАТ СОНЦЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАНОСУПУТНИКА POLYITAN-2	67
Фадєєв М.С., Душейко М.Г., Іващук А.В.	
ЦИФРОВИЙ СЕНСОР КУТОВИХ КООРДИНАТ СОНЦЯ ДЛЯ СУПУТНИКІВ СТАНДАР- ТУ CUBESAT	69
Душейко М.Г., Точковий В.О., Іващук А.В.	
ВПЛИВ ТОВЩИНІ ЕЛЕКТРОДІВ НА ВНУТРІШНІЙ ОПІР СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ	71
Ізотов В.Ю., Клюй М.І., Вей Хан, Ші Лун Лю, Селіхова А.В., Гавриков Д.С.	
ВЛІЯНИЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ПРИМЕСИ НА ДЕТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ CdTe.....	73
Беляев С.В., Гнатюк В.А., Левицкий С.Н.	
ІНДУКОВАНА МЕТАЛОМ КРИСТАЛІЗАЦІЯ АМОРФНОГО КРЕМНІЮ: ПЕРСПЕК- ТИВИ І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ У СОЛНЧНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ	75
Нейман В.Б.	
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ОКСИДНО- НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КОНДЕНСАТОРІВ	77
Лепіх Я.І., Лавренова Т.І.	
МАТЕРІАЛ ДЛЯ ТОВСТОПЛІВКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГІС НА БАЗІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ "СКЛО – ОКСИДИ МЕТАЛІВ"	78
Лепіх Я.І., Лавренова Т.І.	
ПЛЕНКИ Zn _x Cd _{1-x} S, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ СПРЕЙ-ПИРОЛИЗА, ДЛЯ ОКОН ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	79
Ерёменко Ю.С., Демиденко М.Г., Опанасюк А.С., Салогуб А.О., Курбатов Д.И.	
ВПЛИВ ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ КРИСТАЛІВ p-Si	81
Лис Р.М., Павлик Б.В., Дідик Р.І., Шикоряк Й.А.	
ВПЛИВ ПРЕСУВАННЯ НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Sb ₂ Te ₃ - Bi ₂ Te ₃	83
Мартинова К.В., Рогачова О.І.	
STAND ALONE THERMO-PHOTOVOLTAIC POWER PLANT WITH SOLAR RADIATION CONCENTRATOR	84
Kirichenko M.V., Zaitsev R.V., Khrypunov G.S.	
HIGH-VOLTAGE POWER TAKE-OFF SYSTEM FOR PHOTOVOLTAIC STATION	86
Zaitsev R.V., Kirichenko M.V., Khrypunov G.S., Prokopenko D.S.	
ВПЛИВ ГРАФЕНУ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ Cu-HfO ₂ , НАНЕСЕНОЇ ~ НА СКЛЯНУ ПІДКЛАДКУ	88
Негруб М.М., Кравець В.Г., Лопатинська О.Г., Юрзелевич І.В., Поперенко Л.В.	
ABSORPTION CHARACTERISTICS of SiO ₂ , CaO and SOFTWARE “KERN-DP” OF ANISOTROPY AUTOMATED SYSTEM	89
Onanko A.P., Kulish M.P., Dmytrenko O.P., Prodavoda G.T., Vyzhva S.A., Onanko Y. A., Kolendo A. Y., Kutsevol N. V.	

ДОСЛДЖЕННЯ ВІЛИВУ ТОНКИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПАРАМЕТРИ БАР'ЄРНИХ ПЕРЕХОДІВ НА GaAs	119
Дмитрієв В.С., Дмитрієва Л.Б.	
ДОСЛДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РІВНЯ ІНЖЕКЦІЇ БАР'ЄРНИХ ПЕРЕХОДІВ МЕТАЛ- АРСЕНІД ГАЛІЮ ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ	120
Дмитрієв В.С., Дмитрієва Л.Б.	
СТРУКТУРА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВОК Zn_2SnO_4, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПУЛЬСУЮЧОГО СПРЕЙ-ПІРОЛІЗУ	121
Салогуб А.О., Климов О.В., Возний А.А., Опанасюк А.С., Манжос О.П.	
As₂S₃ CHALCOGENIDE GLASSES DOPED WITH Mn FOR THE VIS & IR-TRANSMIT- TING APPLICATIONS AND FABRICATION OF OPTICAL ELEMENTS	123
Paiuk O., Meshalkin A., Stronski A., Achimova E., Abashkin V., Prisacar A., Triduh G., Lytvyn P., Oleksenko P., Kryskov Ts.	
МЕХАНИЗМ РОСТА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НІТЕВИДНИХ НАНОКРИСТАЛЛОВ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ДИФУЗІЮ ГОРЯЧИХ АТОМОВ ПО ПОВЕРХНОСТИ	124
Гранкин Д.В., Гранкин М.В.	
МЕХАНИЗМ РАСТВОРЕНИЯ КРИСТАЛЛІЧЕСКОЇ РЕШЕТКИ МОНОКРИСТАЛ- ЛОВ ZnSe В РАСТВОРЕ БРОМА	125
Беляев С.В., Гнатюк Д.В., Левицкий С.Н.	
ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ СТЕКЛОКЕРАМИКИ СИСТЕМЫ VO₂-V₂O₅-P₂O₅-SnO₂-Cu.....	127
Колбунов В.Р., Ион А.И.	
ВЛИЯНИЕ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВАРИСТОР- НОЙ ОКСИДНО-ЦИНКОВОЙ КЕРАМИКИ	129
Лавров Р.И., Ион А.И.	
ФОНОННІ СПЕКТРИ СПОЛУК Cu₂ZnSnSe₄ ІЗ ЗАМИНОЮ Sn НА Ge АБО Si	131
Бабічук І.С., Гаврилюк Є.О., Лемішко І.С., Джаган В.М., Юхимчук В.О., Валах М.Я., Боднар І.В., Гус М.	
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОСТУ ГЕТЕРОНАНОВІСКЕРІВ GaAs/In_{1-x}GaxAs/GaAs ПРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОМУ CVD-МЕТОДІ.....	134
Губа С.К., Пелещак Р.М., Гуменюк Д.В.	
СТВОРЕННЯ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ InSe – ГРАФІТ	135
Ткачук І.Г., Пощілуйко Р.Л.	
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ГЕТЕРОКОМПОЗИЦИЙ Zn_xCd_{1-x}Te-Si (111), СИНТЕЗИРОВАННЫХ ВАКУУМНЫМ АНОДНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ	136
Москвин П.П., Крыжановский В.Б., Литвин П.М., Ращковецкий Л.В., Рудницкий В.А.	
СПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ GaSe, ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ ГІДРО- ОКСИДОМ КАЛІЮ.....	137
Цибуленко Ю.М.	
ДОСЛДЖЕННЯ ПЛІВОК Mg_xZn_{1-x}O НА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПДКЛАДКАХ Al₂O₃ ГЧ-СПЕКТРОСКОПІї	138
Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Борковська Л.В., Хоменкова Л.Ю., Корсунська Н.О.	
DOPING OF PbI₂ MONOCRYSTALS BY Fe AND Ni IN THE PROCESS OF GROWTH FROM VAPOUR PHASE	139
Rybak O.V.	
АНАЛІЗ СПЕКТРІВ СКАНУЮЧОЇ ТУНЕЛЬНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ МЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИК InSe(Ni)	140
Галій П.В., Ненчук Т.М., Мазур П., Ціжевський А., Яровець І.Р.	
ОДЕРЖАННЯ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ $Na_4M^{II}_3P_4O_{15}$ (M^{II} – Co, Ni)	142
Одинець Є.В., Затовський І.В.	

ПЛЕНКИ $Zn_xCd_{1-x}S$, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ СПРЕЙ-ПИРОЛИЗА, ДЛЯ ОКОН ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Ерёменко Ю.С. , Демиденко М.Г. , Опанасюк А.С., Салогуб А.О., Курбатов Д.И.
Сумський національний університет, вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна
e-mail: yurieremenko1991@gmail.com

Сегодня в сфере солнечной энергетики происходит активный поиск новых материалов для производства солнечных преобразователей третьего поколения. При этом большой интерес представляет изготовление солнечных элементов (СЭ) на основе гетеропереходов (ГП). Сложностью создания таких СЭ является выбор полупроводниковых слоев имеющих одновременно большую разницу ширины запрещенной зоны и хорошо согласованные кристаллические решетки. Ряд материалов оконных слоев, таких как ZnS, CdS, ZnSe и другие, могут быть использованы в комбинации с поглощающими слоями CdTe[1]. Наиболее изученным среди них является CdS, поэтому весьма широкое распространение получили СЭ на основе ГПn-CdS/p-CdTe. В последнее время рассматривают возможность замены традиционного оконного слоя таких фотопреобразователей на твёрдый раствор $Zn_xCd_{1-x}S$, использование которого позволяет увеличить ширину запрещенной зоны (от 2,42 eV у CdS до 3,68eV у ZnS) и соответственно напряжение холостого хода фотопреобразователей, а также уменьшить количество рекомбинационных центров на границе раздела материалов благодаря лучшему согласованию их параметров решетки. В связи с этим $Zn_xCd_{1-x}S$ имеют хорошие перспективы использования в качестве оконного слоя СЭ [2].

Тонкие пленки твердого раствора $Zn_xCd_{1-x}S$ в настоящее время наносят с помощью следующих методов: вакуумное испарение, химическое осаждение из раствора, спрей-пиролиз и другие. Метод пульсирующего спрей-пиролиза является достаточно простым, относительно дешевым методом, позволяющим без использования вакуума наносить наноструктурированные химически чистые пленки с управляемым составом и заданной площадью на подложках из разных материалов. Свойства тонких слоев, полученных спрей-пиролизом, главным образом зависят от выбора прекурсоров и физико-технологических параметров нанесения. В частности, существенное влияние на свойства таких пленок оказывает температура подложки. Поэтому целью данной работы являлось исследование влияния температуры подложки на спектры отражения, пропускания и другие оптические характеристики пленок $Zn_xCd_{1-x}S$, полученных спрей-пиролизом, для их оптимизации, а также оценка перспектив использования таких пленок в качестве оконного слоя СЭ.

Для получения слоев $Zn_xCd_{1-x}S$ была использована лабораторная установка, описанная в [3]. В качестве прекурсора был взят раствор, содержащий 0,125 М тетрагидрат нитрата кадмия, 0,125 М хлорида цинка и 0,125 М тиомочевины, которые служили источниками Cd, Zn и S соответственно. Нанесение пленок проводилось на стеклянные подложки размером $25 \times 25 \times 1$ мм предварительно очищенные с помощью изопропанола. Температура подложки варьировалась в диапазоне 523-773 К с шагом $\Delta T = 50$ К. Расстояние между соплом и поверхностью подложки составляло 25 см. Перенос диспергированных частиц прекурсора производился с использованием потока воздуха под давлением 0,2 МПа. Скорость нанесения пленок составляла 2 мл/мин при объеме распыленного раствора на один образец 10 мл.

Оптические исследования тонких слоев проводились на спектрофотометре ShimadzuSolidSpec 3700 в диапазоне длин волн: $\lambda = (300-800)$ нм с шагом 0,5 нм при режиме сканирования «mediumspeed». Измерения проводились с учетом спектральных характеристик подложки (сначала проводилось снятие базового спектра пропускания чистого стекла, который затем автоматически вычитался из спектра образцов), что обеспечивало максимальную точность определения оптических параметров пленки.

Спектральные зависимости коэффициентов пропускания и отражения для образцов, полученных в интервале температуры подложки $T_s = (523-773)$ К приведены на рис. 1.

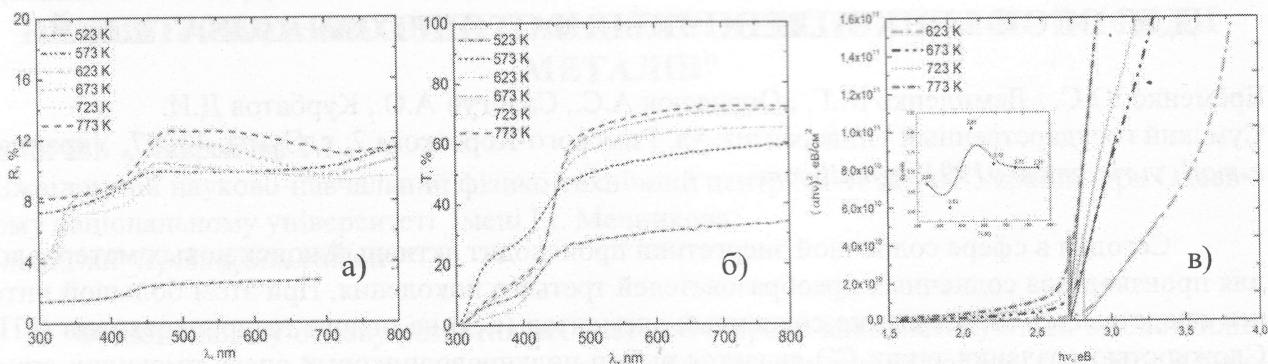


Рис. 1. Спектры отражения (а), пропускания (б) и $(ahv)^2 - hv$ зависимости(в) для пленок $Zn_xCd_{1-x}S$, полученных при температурах подложки $T_s = (523-773)$ К

Как видно из представленных рисунков, полученные пленки твердого раствора $Zn_xCd_{1-x}S$ имеют достаточно низкие показатели коэффициента отражения от поверхности (в пределах 1,5 – 12,5%). При этом отмечается рост значения R при увеличении длины волны λ . Также легко заметить, что коэффициент пропускания данных пленок достигает значения порядка 70%. При этом для конденсаторов, полученных при более высоких температурах подложек, характерны более высокие значения коэффициентов отражения и пропускания. Так как здесь представлены результаты измерений, полученные при освещения образцов со стороны пленки твердого раствора, то, скорее всего, такие показатели связаны с влиянием структурного качества пленок и ярко выраженным рельефом их поверхности. На зависимостях $R(\lambda)$ и $T(\lambda)$ наблюдаются максимумы и минимумы интенсивности, связанные с интерференцией света в тонких слоях. Наличие интерференционных пиков свидетельствуют об однородности исследованных пленок по площади.

Также были построены зависимости $(ahv)^2 - hv$ (рис. 1, в) из которых была определена ширина запрещенной зоны материала, она составляла (2,61-2,81) еВ. Эти значения хорошо согласуются с литературными данными.

В результате исследований было установлено, что благодаря высоким значениям коэффициентов пропускания и достаточно низким значениям коэффициента отражения света от поверхности в широком диапазоне длин волн, полученные пленки $Zn_xCd_{1-x}S$ имеют хорошие перспективы применения в сфере гелиоэнергетики в качестве оконных слоев СЕ с поглощающим слоем CdTe.

Список использованной литературы

1. Kurbatov D. I. Structural and electrical properties of $ZnS/CdTe$ and $ZnTe/CdTe$ heterostructures / D. I. Kurbatov, V. V. Kosyak, M. M. Kolesnyk[et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2013. – V. 138, №2-3. – P. 731–736.
2. Kartopu G. Effect of window layer composition in $Cd_{1-x}Zn_xS/CdTe$ solar cells / G. Kartopu, A. J. Clayton, W. S. M. Brooks[et al.] // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. – 2012. – V. 20, №1. – P. 6–11.
3. Dobrozhany O., Opanasyuk A., Kolesnyk M., Demydenko M., Cheong H. Substructural investigations, Raman and FTIR spectroscopies of nanocrystalline ZnO films deposited by pulsed spray pyrolysis // Phys. Status Solidi A – 2015. – V. 1-7. – P. 2915–2921.

НМІТФ – 2016

($N_d = 10^{16} \text{ см}^{-3}$), малою концентрацією n_i (при $n_{i\text{GaAs}} = 1,79 * 10^6 \text{ см}^{-3}$, $\gamma_{\text{Ag/n-GaAs}} = \sim 10^{-10} \dots 10^{-11}$), яка відповідає більшій ширині забороненої зоні, більшим значенням щільності струму насищення I_s (що відповідає малій висоті бар'єру).

Список використаної літератури

1. Дмитриев В. С. Исследование инжекционных свойств контактов металл-полупроводник / В. С. Дмитриев, Е. Я. Швец, Л. Б. Дмитриева // Материалы межнародной научово-практической конференции «Украина-Польша: диалог культур в контексте евроинтеграции». – Запорожье : ЗДІА. – 2014. – Т. 2. – С. 226-228.
2. Швец Е. Я. Исследование влияния структуры переходного слоя на качество барьера Шоттки / Е. Я. Швец, В. С. Дмитриев: Сб. науч.тр. // Материалы V международной научной конференции «Функциональная база наноэлектроники» – Харьков-Кацивели : ХНУРЭ. – 2012. – С. 169-172.

УДК 538.975:539.23

СТРУКТУРА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВОК Zn_2SnO_4 , ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПУЛЬСУЮЧОГО СПРЕЙ-ПРОЛІЗУ

Салогуб А.О., Климов О.В., Возний А.А., Опанасюк А.С., Манжос О.П.

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна.

E-mail: annkasalohub@gmail.com, opanasyuk_sumdu@ukr.net

Станат цинку (Zn_2SnO_4 або ZTO) з атомною структурою шпінелю AB_2O_4 через високу радіаційну, хімічну та механічну стійкість є перспективним матеріалом сучасної електроніки. Завдяки унікальному поєднанню оптичних та електричних властивостей він знаходить широке використання для виготовлення газових сенсорів, літій-іонних батарей, енергозберігаючих вікон, фотодетекторів, фільтрів випромінювання, фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії тощо [1]. Слід відзначити, що майже всі тонкоплівкові сонячні елементи з рекордними параметрами на основі поглинаючих шарів CdTe та CIGS як прозорий струмопровідний контактний матеріал містять шари ZTO [2].

Для широкомасштабного застосування плівок ZTO ключовим моментом є розробка простих та ефективних методів їх нанесення на різноманітні підкладки великої площини. На сьогоднішній день існує велика кількість методів отримання плівок станату цинку: магнетронне розпилення, метод хімічного осадження з газової фази, хімічне осадження з водного розчину, спрей-піроліз, золь-гель метод та ін. Однак метод пульсуючого спрей-піролізу, займає серед них ключове місце, адже є більш простим, економічним та зручним методом нанесення тонких плівок при низьких температурах у відсутності вакуума.

Для осадження тонких плівок методом пульсуючого спрей-піролізу в ролі початкового прекурсору нами використовувалися наступні водні розчини: 2,5 M – $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 5 M – $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ та декілька крапель HNO_3 . Під час розпилювання, дисперсні частинки прекурсора при наближенні до нагрітої поверхні підкладки піддавалися піролітичним (ендотермічним) процесам розкладання, у результаті чого відбувалося подальше утворення плівок ZTO.

Для нанесення зразків, скляні підкладки були очищені та обезжирені ультразвуком протягом 16 хвилин, після чого промиті чистою водою й етанолом. У подальшому прекурсор розпорошували на нагріту до необхідної температури підкладку. Швидкість розпилення становила 0,2 мл/хв, а об'єм розчину, необхідний для отримання зразка, – 6 мл. Відстань між соплом і поверхнею підкладки складала 23 см. Для транспорту диспергованих частинок ви-

користувався потік повітря під тиском 0,2 МПа. Діапазон температур підкладки, що використовувалася при синтезі плівок, становив $T_s = (250 - 450) ^\circ\text{C}$ з кроком $\Delta 50 ^\circ\text{C}$. Більш детально технологія отримання плівок оксидів методом пульсуючого спрей-піролізу описана в [3].

Структурні дослідження нанесених шарів були виконані на автоматизованому рентгенодифрактометрі ДРОН-4-07 у Ni-фільтрованому Ка випромінюванні мідного анода. Морфологія поверхні плівок, їх фрактограми, а також хімічний склад досліджувалися за допомогою скануючого електронного мікроскопу Hitachi S-4800, що має детектор зворотного розсіювання рентгенівських променів Bruker та програму для мікроаналізу QUANTAX 400.

Оптичні дослідження напівпровідникових плівок проводилися на спектрофотометрі Solid Spec-3700 UV-VIS-NIR в інтервалі довжин хвиль $\lambda = (300-1500)$ нм. Знімалися спектральні залежності коефіцієнта відбиття $R(\lambda)$ та пропускання $T(\lambda)$. Для вимірювання спектрів відбиття світла використовувалася спеціальна приставка. Вона забезпечувала подвійне відбиття світла від поверхні експериментальних зразків при зніманні, з урахуванням його відбиття від контрольного зразка.

Рентгенівський аналіз показав, що отримані плівки мають полікристалічну структуру кубічної модифікації. Зі збільшенням температури підкладки, розмір кристалітів в зразках збільшувався.

За результатами аналізу елементного складу зразків нами знаходилися відношення атомних концентрацій компонентів CZn/CSn , CZn/CO , CSn/CO , CZn+Sn/CO у тонких шарах. Результати розрахунків наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 Хімічний склад отриманих плівок

T_s , $^\circ\text{C}$	Відношення атомних концентрацій компонентів сполуки			
	$\gamma_1 = \text{CZn/CSn}$	$\gamma_2 = \text{CZn/CO}$	$\gamma_3 = \text{CSn/CO}$	$\gamma_4 = \text{CZn+Sn/CO}$
250	0,632	0,072	0,114	0,187
300	0,515	0,013	0,026	0,039
350	0,431	0,014	0,031	0,045
400	0,309	0,009	0,028	0,037
450	0,356	0,013	0,036	0,049
-	0,275	1,022	3,712	4,734

Результати дослідження показали, що зі збільшенням T_s атомна концентрація Sn у шарах зменшується від $\gamma_1 = \text{CZn/CSn} = 0,632$ ($250 ^\circ\text{C}$) до $\gamma_1 = 0,356$ ($450 ^\circ\text{C}$). В той же час відношення $\gamma_4 = \text{CZn+Sn/CO}$ (відомо, що Sn заміщує Zn у кристалічній гратці) при низьких температурах ($T_s = 250 ^\circ\text{C}$) становить 0,19 і зменшується до 0,37-0,49 при подальшому зростанні T_s . Цей результат може означати, що зразки перенасичені киснем або при дослідженні елементного складу електронний промінь, пройшовши плівку, дійшов до скляної підкладки, яка містить кисень.

Оптичні дослідження дозволили встановити, що при довжині хвилі більшій ніж та, що відповідає краю полоси поглинання матеріалу ($\lambda = 390$ нм), досліджені плівки мають високий коефіцієнт пропускання світла $T = 78-89\%$; щодо коефіцієнту відбивання випромінювання від тонких шарів, то він сягає значень $R = 6,7-14,4 \%$. Зі збільшенням температури отримання коефіцієнт відбивання дещо збільшується.

Для визначення ширини забороненої зони матеріалу будувалися залежності $(\alpha h\nu)^2 - h\nu$. Встановлено, що E_g змінюється в інтервалі 4,04-4,20 еВ. При цьому спостерігалася тенденція до зменшення ширини забороненої зони напівпровідника при збільшенні температури отримання плівок, що можна пояснити збільшенням розміру зерен у шарах від нано- до мікрокристалічних при підвищенні температури їх нанесення.

Завдяки високій пропускній здатності та ширині забороненої зони, отримані шари можуть бути використані як вікна та струмопровідні шари тонкоплікових сонячних елементів на основі різних поглинаючих матеріалів.

Список використаної літератури

1. Saafi I., Dridi R., Mhamdi A. et al. Study of thickness effects on structural and optical properties of sprayed Zn_2SnO_4 thin films // Optik-International Journal for Light and Electron Optics. – 2015. – V.128. – P. 4382-4386.
2. Scheer R., Schock H.-W. Chalcogenide Photovoltaics. Physics, Technologies and Thin Films Devices. – Wiley-VCH, 2011. – 368 p.
3. Dobrozhany O., Opanasyuk A., Kolesnyk M. et al. Substructural investigations, Raman and FTIR spectroscopies of nanocrystalline ZnO films deposited by pulsed spray pyrolysis // Phys. Status Solidi A – 2015. – V. 1-7. – P. 2915–2921.

UDC 538.22; 535.421

As₂S₃ CHALCOGENIDE GLASSES DOPED WITH Mn FOR THE VIS & IR-TRANSMITTING APPLICATIONS AND FABRICATION OF OPTICAL ELEMENTS

Paiuk O.¹, Meshalkin A.², Stronski A.¹, Achimova E.², Abashkin V.², Prisacar A.², Triduh G.², Lytvyn P.¹, Oleksenko P.¹, Kryskov Ts³.

¹ V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, 41 Nauky ave., 03028 Kyiv, Ukraine, e-mail: stronski@isp.kiev.ua, paiuk@ua.fm

² Institute of Applied Physics AS of Moldova, 5 Academiei str., 2028 Chisinau, Moldova.

³ Kamianets-Podilsky National University, 61 I.Ogienko str., 32300 Kamianets-Podilsky, Ukraine.

Chalcogenide glasses are of considerable interest for use as optical elements in IR-transmitting applications because of their transparency over a wide wavelength range in the IR region, and a variety of possible applications can be envisaged depending on the wavelength of the light involved. Doping of chalcogenide glasses by transitional elements changes their thermal, optical, structural and magnetic properties. Pure chalcogenide glasses As₂S₃ are diamagnetics. Measurements of mass magnetization M in the field 6 T and the temperature range from 1 to 350 K give values for As₂S₃: $M_{mid} = -1,11 \times 10^{-6}$ A m²/kg. Introduction of Mn with concentrations – 2 weight % changes magnetic properties of investigated chalcogenide glasses. In DC magnetic field (B = 6 T) dependence of mass magnetization M=M(T), is observed which is characteristic for paramagnetics and ferromagnetics in paramagnetic region of temperatures and described by Curie-Weiss law. The dc magnetization measurements were performed with the SQUID magnetometer. Magnetization temperature (M-T) curves were measured from 5 K to 300 K in the ZFC, the FC modes with an applied magnetic field B from 0.0005 T to 6 T. In the ZFC measurements, the sample was cooled from room temperature to 5 K in a zero magnetic field, then a field was applied at 5 K, and the M_{ZFC} was measured in the warming cycle, then the M_{FC} was performed in the cooling cycle. Through the analysis of the M-T curves of As₂S₃:Mn 2 weight % under different value B, we found that difference between M (T) dependences for ZFC and FC curves remains up to the value of the external field B=0.0468 T and disappears in the field 0.197 T. This gives possibility to consider that influence of the external field on the orientation of the intrinsic magnetic moments of the dopant atoms on the energy value exceeds the energy of their thermal movement.

Chalcogenide nanomultilayer structures based on As₂S₃:Mn – Se systems have potential in production of surface-relief optical elements and have been investigated as amplitude-phase optical recording media for optical information recording applications such as diffraction gratings, holograms, etc. Amorphous As₄₀S₆₀:Mn–Se nanomultilayer structures were prepared by cyclic thermal vacuum deposi-